物理学报Acta Physica Sinica





Institute of Physics, CAS

Han Jian-Wei

空间用GaN功率器件单粒子烧毁效应激光定量模拟技术研究 崔艺馨 马英起 上官士鵰 康玄武 刘鹏程 韩建伟 Research on Single Event Burnout of GaN power devices with femtosecond pulsed laser Cui Yi-Xin Ma Ying-Qi Shangguan Shi-Peng Kang Xuan-Wu Liu Peng-Cheng 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 71, 136102 (2022) DOI: 10.7498/aps.71.20212297 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.71.20212297 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

氮化镓基高电子迁移率晶体管单粒子和总剂量效应的实验研究

Single event effect and total dose effect of GaN high electron mobility transistor using heavy ions and gamma rays 物理学报. 2021, 70(11): 116102 https://doi.org/10.7498/aps.70.20202028

基于光纤中超短脉冲非线性传输机理与特定光谱选择技术的多波长飞秒激光的产生

Generation of multi-wavelength femtosecond laser pulse based on nonlinear propagation of high peak power ultrashort laser pulse in single-mode fiber and spectral selectivity technology

物理学报. 2018, 67(18): 184205 https://doi.org/10.7498/aps.67.20181026

选择性埋氧层上硅器件的单粒子瞬态响应的温度相关性

Temperature dependence of single-event transient response in devices with selective-buried-oxide structure 物理学报. 2019, 68(4): 048501 https://doi.org/10.7498/aps.68.20191932

锁频锁相的高功率微波器件技术研究

Review on high power microwave device with locked frequency and phase 物理学报. 2018, 67(8): 088402 https://doi.org/10.7498/aps.67.20172684

基于锯齿波脉冲抑制自相位调制的高功率窄线宽单频脉冲光纤激光放大器

High-power narrow-linewidth single-frequency pulsed fiber amplifier based on self-phase modulation suppression via sawtooth-shaped pulses

物理学报. 2021, 70(21): 214202 https://doi.org/10.7498/aps.70.20210496

不同散射介质对飞秒脉冲激光传输特性影响研究

Influence of different scattering medium on propagation characteristics to femtosecond laser pulses 物理学报. 2019, 68(19): 194207 https://doi.org/10.7498/aps.68.20190430

空间用 GaN 功率器件单粒子烧毁效应 激光定量模拟技术研究*

崔艺馨1)2) 马英起1)2)† 上官士鹏1) 康玄武3) 刘鹏程1)2) 韩建伟1)2)

(空间天气学国家重点实验室,中国科学院国家空间科学中心,北京 100190)
 2)(中国科学院大学天文与空间科学学院,北京 100049)
 3)(中国科学院微电子研究所,北京 100029)

(2021年12月13日收到; 2022年3月8日收到修改稿)

利用飞秒脉冲激光对氮化镓 (GaN) 功率器件进行单粒子烧毁效应定量评估技术研究,针对器件结构建 立脉冲激光有效能量传输模型,理论计算了激光有效能量与重离子线性能量传输 (LET) 的等效关系并开展 了试验验证.考虑器件材料反射率与吸收系数对激光的影响,针对介质层界面间的激光多次反射进行参数修 正,减小有源区有效能量计算误差.选择一款氮化镓高电子迁移率晶体管 (GaN HEMT) 与一款肖特基势垒二 极管 (SBD) 功率器件作为典型案例,分别开展飞秒脉冲激光正面与背部辐照试验,计算诱发单粒子烧毁的有 效能量,并得到不同入射激光波长的烧毁等效 LET 阈值,对比了模型理论计算值与实际测量值.同时,研究 结果对材料参数未知的 GaN功率器件,提供了正面与背部辐照模型的激光试验波长选择参考.该工作将为激 光定量评估空间用 GaN 等宽禁带半导体器件的单粒子烧毁效应机理研究及加固设计与验证提供技术支撑.

关键词:氮化镓功率器件,飞秒脉冲激光,单粒子烧毁效应,等效 LET 值
 PACS: 61.80.Az, 61.80.Ba, 78.55.Cr, 61.80.Jh
 DOI: 10.7498/aps.71.20212297

1 引 言

GaN 功率器件作为新型电子电力元件,具有 宽禁带、体积小、高击穿电压、高开关频率等优点^[1-3], 相较于传统 Si 基器件在高压电源领域具有更广阔 的应用前景,在航天中已得到初步应用^[4,5].重离子 可使 GaN 功率器件发生单粒子效应 (single event effect, SEE),当引起器件单粒子烧毁 (single event burnout, SEB)时会导致电源系统灾难性故障,从 而无法保证设备正常运行^[6,7].因此,在空间电源系 统中确定关键器件的抗辐射性能特别是突出的 SEB 效应十分必要. 2015年 Scheick^[8] 首次在常关型 GaN 功率器 件中观察到 SEB 的出现,国际上前期工作主要分 析了质子位移损伤对器件的影响^[9–11]. Zerarka 等^[12] 通过数据仿真提出了导致 SEB 的两种可能机制, Martinez 等^[13] 发现 GaN HEMT 在发生 SEB 时 存在栅漏极短路点,研究表明器件 SEB 敏感区域 位于栅漏之间^[8,14]. 上述试验主要利用地面重离子 加速器开展,分析了器件辐照前后电学特性的变 化,并初步探究了特定器件的 SEB 损伤模式,仍需在 GaN 功率器件 SEB 失效分析及损伤阈值及机制 等方面开展大量工作. 脉冲激光主要通过光电效应 等效重离子诱发 SEB 试验结果,具有快速测定器 件安全工作区、探测敏感区域范围等优势. 针对 Si 基

© 2022 中国物理学会 Chinese Physical Society

^{*} 中国科学院青年创新促进会 (批准号: 2018179)、广东省重点研发计划 (批准号: 2020B010170001) 和北京市科学技术委员会项目 (批准号: Z201100003520002) 资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: myq@nssc.ac.cn

功率器件 SEB 试验激光手段已被广泛应用[15-17], 但在 GaN 等宽禁带半导体器件 SEB 激光评估方 面需要进行系列关键技术研究. Ngom 等^[18]使用 飞秒脉冲激光背部入射 GaN HEMT 器件,讨论波 长对其穿透深度等参数的影响,获得 SEE 与入射 波长的依赖关系;蒙彼利埃大学 Roche 与美国海 军研究实验室 Khachatrian 等^[19-21] 基于单光子吸 收 (single-photon absorption, SPA) 机制利用紫外 波段脉冲激光对 GaN HEMT 定制器件进行 SEE 研究获得了单粒子瞬态 (single event transient, SET) 不同波形特征,并在 GaN 材料中测试激光双光子 吸收 (two-photon absorption, TPA) 引起的空间 电信号脉冲,从正面入射 GaN 二极管产生 SET 响应, 为激光 TPA 技术用于模拟重离子诱发 GaN 器件 SEB 提供试验参考. 激光与重离子等效关系 一直以来是阻碍脉冲激光定量评估 SEB 的关键技 术问题,建立脉冲激光与重离子能量的对应关系、 定量评估器件发生 SEB 阈值亟需充分研究.

中国科学院国家空间科学中心已初步建立正 面入射 GaN HEMT 器件的激光能量传输模型^[22], 并据此计算了与重离子线性能量传输 (linear energy transfer, LET) 的等效关系. 本文主要研究脉冲 激光对 GaN 功率器件 SEB 效应的定量评估技术, 在前期基础上完善正面入射激光能量传输模型,并 进行关键参数校正;同时建立背部入射激光能量传 输模型,使两种模型普遍适用于不同类型的 GaN 功率器件, 据此建立激光与重离子 LET 的定量对 应关系.利用空间中心自行搭建的飞秒激光测试装 置,对两款不同类型的 GaN 功率器件开展试验, 将器件发生 SEB 时的脉冲激光有效能量与重离子 LET 数据进行对比, 获得了良好的等效关系. 本文 的工作将有助于 GaN 功率器件的 SEB 定量评估 研究,为空间用 GaN 功率器件的安全工作区域确 定、机理研究及加固设计验证提供技术支撑.

2 理论模型建立与数值计算

2.1 激光有效能量传输模型建立

基于 AlGaN/GaN 异质结的 GaN 功率器件, 在 GaN 层侧因自发和压电极化效应形成横向高密 度且迁移率明显高于体电子的二维电子气 (twodimensional electron gas, 2DEG), 2DEG 在器件 中是极其重要的导电通道.在进行脉冲激光实验 时,激光穿过介质层聚焦于 GaN 层 2DEG 周围有 源区发生光电作用,当激光有效能量的转化电荷超 过器件承受阈值时发生单粒子烧毁效应.对基于 AlGaN/GaN 异质结的 GaN 功率器件进行有源区 激光有效能量定量评估,根据器件不同的结构类 型,可建立正面入射和背部入射的两种有效能量传 输模型.

对于 GaN HEMT 等背部有金属的 GaN 功率 器件,可选择对器件开正面封装,使脉冲激光从正 面进行辐射试验. GaN HEMT 的金属布线层间隙 大于激光光斑尺寸,激光可通过器件栅漏之间的金 属布线层间隙到达有源区产生电子-空穴对,从而 引发单粒子效应. 正面入射的 GaN 功率器件激光 有效能量传输模型如图 1 所示.



图 1 正面入射的脉冲激光能量传输模型

Fig. 1. Pulsed-laser energy transmission model with frontal incidence.

激光能量传输过程中,激光会经历器件表面 SiN_x层的反射、SiN_x及Al_xGa_{1-x}N层的光衰减、 Al_xGa_{1-x}N及GaN界面的反射,传输角度考虑器 件为理想化的垂直正入射.依据几何光学的传播特 性,建立脉冲激光能量传输衰减的计算模型.最终 达到有源区的激光能量 *E*_{eff} 如下式所示:

 $E_{\text{eff}} = (1 - R_1)(1 - R_2)(1 - R_3)t_1t_2E_0 + E'$, (1a) 其中 E_0 是入射到器件表面的激光脉冲能量; R_1 是 器件表面 SiN_X 层对激光的反射率; R_2 是 SiN_X 层 与 $Al_xGa_{1-x}N$ 层交界面对激光的反射率; R_3 是 $Al_xGa_{1-x}N$ 层与 GaN 层交界面对激光的反射率; t_1 是 SiN_x 层的材料透光系数; t_2 是 $Al_xGa_{1-x}N$ 层的 材料透光系数; t_1, t_2 均与材料对激光的吸收作用 有关; E'是界面层间多次反射进入有源区的激光 脉冲能量. GaN HEMT 功率器件往往会有场板、 帽层等更为复杂的设计影响激光能量的传输效率.



图 2 背部入射的脉冲激光能量传输模型 (a) 背部开孔的 HEMT 器件; (b) SBD 器件

Fig. 2. Pulsed-laser energy transmission model with back incidence: (a) HEMT device with hole on the back; (b) SBD device.

在进行有源区激光有效能量定量计算时,可结合器件的实际结构,将复杂结构的材料系数加入 *E*_{eff}的公式计算,从而使得计算结果更为精准.

对于横向结构肖特基 (SBD) 二极管等背部没有 金属的 GaN 功率器件,选择对器件开背部封装,使脉 冲激光从背部进行辐射试验;对于衬底较薄的 GaN HEMT 器件,也可以在背部金属上进行特定大小 (开 孔大小至少覆盖一组源栅漏极结构重复单元)的金属 开孔,完成背部衬底减薄的辐射实验.背部入射的 GaN 功率器件激光有效能量传输模型如图 2 所示.

当激光从背部入射进行辐射实验时,器件表面的激光会经历衬底层的反射、因材料光子吸收导致衬底层的光衰减、GaN界面的反射与GaN层的光衰减、Al_xGa_{1-x}N界面的反射与Al_xGa_{1-x}N层的光衰减、金属层的二次反射后到达有源区诱发器件产生单粒子效应.传输角度考虑器件为理想化的垂直正入射.依据几何光学的传播特性,建立脉冲激光能量传输衰减的计算模型.最终达到有源区的激光能量 E_{eff} 如下式所示:

$$E_{\text{eff}} = (1 - R_5) (1 - R_4) [1 + (1 - R_3)^2 t_3 t_2^2 R_0] t_4 E_0 + E', \quad (1b)$$

其中 E_0 是入射到器件表面的激光脉冲能量; R_5 是 器件衬底表面对激光的反射率; R_4 是 GaN 层与衬 底交界面对激光的反射率; R_3 是 Al_xGa_{1-x}N 层与 GaN 层交界面对激光的反射率; R_0 是金属布线层 与 Al_xGa_{1-x}N 层交界面对激光的反射率; t_4 是衬底 的材料透光系数; t_3 是 GaN 层的材料透光系数; t_2 是 Al_xGa_{1-x}N 层的材料透光系数; t_4 , t_3 , t_2 均与 材料对激光的吸收作用有关;E'是界面间多次反 射进入有源区的激光脉冲能量.与正面辐射的激光 有效能量传输模型相比,除了同样需要考虑特殊复杂结构,背部辐射还需考虑金属二次反射对有源区有效能量的影响,即当激光穿过垂直方向上有金属电极的有源区时,(1b)式中*R*₀不为0,需要考虑金属反射的作用.

2.2 关键参数确定

为了定量模拟激光诱发 GaN 功率器件单粒子 烧毁效应,需要确定激光与器件的关键参数.激光 关键参数主要为激光波长的选择,器件关键参数主 要为脉冲激光能量传输模型中各层材料的透光系 数与反射率,同时对界面间激光多次反射的能量值 等参数也应进行分析.

2.2.1 激光波长选择

在选择试验激光波长时,激光入射器件的光生 电流敏感程度与选择的波长有很大的关系. 激光辐 照半导体材料时,根据产生一个电子-空穴对所吸 收的光子数量,分为单光子吸收、双光子吸收、多 光子吸收机制. TPA 指在高激光强度下吸收两个 光子产生单个电子-空穴对,同时仅在光束焦点附 近作用效果显著,传输光路中因光束尺寸的增加使 得激光强度不足以产生 TPA, 与 SPA 相比具有更 好的空间分辨率与更长的穿透深度. GaN 禁带宽 度为 3.4 eV. 发生 TPA 的波长范围为 364-729 nm. 图 3 表示了不同波长在 GaN 材料中的穿透深度, 商用 GaN HEMT 功率器件的有源区多在正面 6 um 以下位置,背部入射时器件缓冲层厚度也多在 4 µm 以上,因此在进行激光模拟 GaN 功率器件单粒子 烧毁效应试验中,选择 TPA 的实验波长时以 600-729 nm 之间为佳.





Fig. 3. Laser penetration depth in GaN materials at different wavelengths.

2.2.2 介质层透光系数与反射率确定

在正面入射模型中,对 GaN 功率器件的介质 层透光系数进行分析,钝化层材料 Si₃N₄ 的禁带宽 度为 5.1 eV, TPA 波段的激光在穿过该介质层时, 光子能量不足以引发 SPA 与 TPA,透射损耗较 低,因此在激光有效能量传输模型中,SiN_X层材料 对光子近乎不吸收,可视为完全透光;Al_xGa_{1-x}N 介 质层厚度极薄,如表 1 所列,在 TPA 适宜波长范围 内,常用材料 Al_{0.2}Ga_{0.8}N 因吸收导致的光损在 0.1% 左右,激光穿过该介质层的光损可以忽略;当衬底 材料为蓝宝石时,蓝宝石对于 TPA 波段的激光波 长透明.因此在模型计算中,各层材料对激光无吸收 影响,主要考虑材料界面的反射率导致的光损失.

在背部入射模型 (蓝宝石衬底) 中, 应考虑金 属布线层的二次反射对有源区能量的影响, 而到达 金属布线层的能量则受 GaN 层的透光系数制约. GaN 层的透光系数 t_1 与 β 呈反比关系, 其中 β (cm/GW) 是 GaN 材料的 TPA 系数. β 与激光波长相关, 即 背部入射的激光有效能量传输模型受波长的影响 较大.

表 1 不同波长的激光在不同厚度的 Al_{0.2}Ga_{0.8}N 中的吸收系数与光损

Table 1. Absorption coefficients and optical losses of different laser wavelengths in different thicknesses of $Al_{0.2}Ga_{0.8}N$.

波长/nm	600	620	650	700	720
吸收系数/cm ⁻¹	210	190	172	155	143
30 nm厚光损	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.04%
50 nm厚光损	0.1%	0.1%	0.09%	0.08%	0.07%
70 nm厚光损	0.14%	0.13%	0.12%	0.11%	0.1%

计算器件介质层间的界面反射率,首先需要获 得 SiN_X, Al_xGa_{1-x}N, GaN 等材料层的空气中反射 率与折射率. 以 GaN 器件常用材料系数为例,在 TPA 适宜波长范围内,不同波长的激光在材料中 的空气中反射率与折射率如表 2 所列^[23].

各层材料空气中反射率和折射率在不同波长 下区别很小,在正面入射的激光有效能量传输模型 中,SiN_X,Al_xGa_{1-x}N,GaN介质层在TPA使用波 段内可取空气中反射率为0.117,0.14和0.168,折 射率可取2.04,2.18和2.31,蓝宝石作为衬底时, 反射率可取0.08,折射率可取1.76计算.

器件介质层间的界面两侧为两种不同的介质, 在进行界面反射率计算时,需要利用菲涅尔公式进 行修正,修正公式如下式所示:

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2,$$
 (2a)

其中n₁,n₂分别为界面两侧不同介质的折射率;R 为界面反射率,激光从界面两侧介质分别入射的界 面反射率相同.带入折射率通用值可得到模型中SiN_x

表 2 不同波长的激光在材料中的空气中反射率与折射率

Table 2.	The reflectivity and refra	ctive index of dif	ferent laser wav	elengths from ai	r to the materia	l.	
业学会粉	++*/	波长/nm					
儿子参姒	们们	600	620	650	700	720	
	${ m Si}_3{ m N}_4$	0.118	0.117	0.117	0.116	0.116	
它与中丘时变	$\rm Al_{0.2}Ga_{0.8}N$	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
空气甲反射率	GaN	0.169	0.168	0.167	0.165	0.165	
	蓝宝石	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
折射率	${ m Si}_3{ m N}_4$	2.04	2.04	2.04	2.03	2.03	
	$\rm Al_{0.2}Ga_{0.8}N$	2.18	2.18	2.18	2.17	2.17	
	GaN	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	
	蓝宝石	1.76	1.76	1.76	1.76	1.75	

层与 $Al_xGa_{1-x}N$ 层的界面反射率 (R_2) , $Al_xGa_{1-x}N$ 层与 GaN 层的界面反射率 (R_3) , GaN 层与衬底 (蓝宝石) 的界面反射率 (R_4) 分别为 0.11%, 0.08% 和 1.9%.

由上分析可得,除金属布线层外,介质层间的 界面反射率普遍较小,即激光入射器件各层材料 时,能量衰减主要受表面材料的空气中反射率影 响.如2.1所述,器件加入 AlN 帽层等复杂结构设 计时,由于 AlN 材料的折射率与 Al_aGa_{1-a}N 及 GaN 材料的折射率极为接近,使用 (2a) 式进行计算后 介质层间的界面反射率仍旧较小; AlN 材料禁带宽 度较大,对 TPA 波段的激光没有吸收损耗,因此 2.1 的激光有效能量传输模型可对 GaN 功率器件 进行通用计算.

2.2.3 界面间激光多次反射能量分析

激光入射器件传输至有源区的过程中,激光在 介质层的界面间会进行多次反射.为了清楚地显示 激光在介质间多次反射的过程,并定量分析多次反 射后的透射能量大小,图4以三层介质为例示意界 面间激光反射过程,为清楚表现激光传输的状态, 所示光束有一定的入射角度,计算中仅考虑正入射 情况.



图 4 脉冲激光在介质层间多次反射示意图 Fig. 4. Schematic diagram of the pulsed laser light reflecting between dielectric layers.

计算透射的所有能量,发现多次反射后透射能 量之和趋于级数收敛,得到激光穿过两层界面后的 激光总透射率 T 为

$$T = (1 - R_{a}) (1 - R_{b}) [1 + R_{a}R_{b} + (R_{a}R_{b})^{2} + (R_{a}R_{b})^{3} + \cdots] = \frac{(1 - R_{a}) (1 - R_{b})}{1 - R_{a}R_{b}}, (2b)$$

其中 R_a, R_b分别为两层界面的反射率.将上述结果 与器件界面反射率带入激光有效能量传输模型计 算,得到界面间多次反射后透射的能量之和仅为有 效能量的 0.01%,即界面间多次反射影响可忽略.

2.3 激光等效 LET 值计算方法

在进行 GaN 功率器件脉冲激光能量等效 LET 值计算时,选择 TPA 激光波段入射器件,不同深 度的激光功率为

$$\mathbf{d}I = -\beta I^2 \mathbf{d}x,\tag{3a}$$

其中I(W)是激光功率; x(cm)是半导体的深度. 带 $\Lambda I = E_{eff}/ws$ (w为脉冲宽度, s为光斑面积), 得到:

$$\frac{\mathrm{d}E\left(x\right)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\beta}{ws}E^{2}(x),\qquad(3\mathrm{b})$$

其中 *E*(*x*) 是入射激光能量.依据脉冲激光和重离子在器件敏感区域单位长度上产生等量的电离电荷,脉冲激光的等效 LET 值理论上可以表述如下:

$$\text{ELET} = \frac{e_{\rm f}}{\rho} \cdot \frac{\mathrm{d}E_{\rm eff}}{\mathrm{d}x},\tag{3c}$$

其中 ρ 为 GaN 材料密度,为 6.1 g/cm³, ELET (MeV·cm²·mg⁻¹) 为等效 LET 值,在 TPA 中 e_f 为 重离子产生一个电子-空穴对所需能量与脉冲激光 两个光子能量的比值, E_{ion} 是粒子在 GaN 材料中 激发—对电子-空穴对所需的能量,为 8.9 eV.

脉冲激光有效能量等效 LET 值的表达式简化 如下:

ELET =
$$\frac{E_{\rm ion}}{\rho} \left(\frac{\lambda \beta}{2hcws} E_{\rm eff}^2 \right) = \frac{\beta}{\rho ws} e_{\rm f} E_{\rm eff}^2$$
, (3d)

其中 λ 为激光波长; h与c均为常数; ω 与s在激光 测试系统中为固定参数; E_{eff} 由脉冲激光有效能量 传输模型可得.脉冲激光有效能量等效 LET 值公 式在 TPA 波长下可简化为

$$\text{ELET}_{\text{wavelength}} = k \times E_{\text{eff}}^2, \qquad (3e)$$

其中 k 为某波长下 ELET 的激光等效系数; *E*_{eff} 激 光有效能量单位为 nJ.

在等效 LET 的计算中, GaN 的 TPA 系数 β (cm/GW) 需要进行参数确定^[24,25]. 使用 (3f) 式可 进行 β 值计算, 具体如下:

$$\beta_{\text{wavelength}} = a \times K \times \sqrt{\frac{E_{\text{p}}}{n^2 E_{\text{g}}^3}} \times F\left(\frac{hv}{E_{\text{g}}}\right)$$
(3f)

其中*a*为取值 12 的经验常数; *K*为取值 1940 的材 料参数; *E*_p是直接带隙半导体的一个与材料无关 的参数,取值为 21 eV; *n*为 GaN 材料的折射率; *E*_g 为 GaN 材料的禁带宽度; *hv* 为激光光子能量,函数 关系 $F(x) = \frac{(2x-1)^{1.5}}{(2x)^5}$. 将参数带入, 600—729 nm 波长下的 β 值如图 5 所示.



图 5 不同波长下 GaN 材料的 β 值 Fig. 5. β of GaN materials at different wavelengths.

3 试验装置与试验对象

3.1 试验装置

中国科学院国家空间科学中心单粒子效应飞 秒脉冲激光试验装置如图6所示,主要由激光器、 光路系统、载物台、测试系统、计算机组成.飞秒脉



冲激光器脉宽为 35 fs,脉冲重复频率为 5 KHz;激 光聚焦光斑尺寸达亚微米级,能量在 1 nJ—1 μJ 范围调节; XYZ 三维载物台分辨率为 1 μm,移动 速度为速度为 5000 μm/s;测试系统的电流采样率 为 0.05 s.试验中,选择 TPA 适宜范围内 620 和 720 nm 两个激光波长进行具体测试.

3.2 试验对象

本研究所用典型器件有两款,器件 1 为 HD-GIT 结构的 X-GaN 系列商用增强型器件,漏源击穿电压为 600 V,用于正面入射脉冲激光有效能量传输模型,反剖器件的结构与参数如图 7 所示;器件 2 为中国科学院微电子研究所自主研发的蓝宝石衬底 GaN SBD 功率器件,两极间反向击穿电压为 100 V,用于背部入射脉冲激光有效能量传输模型.通过对两款器件进行全芯片激光扫描测试与典型位置理论值计算,完成对激光有效能量传输模型与激光等效重离子 LET 值的技术研究.









Fig. 7. Device structure parameters and laser incident positions: (a) Device 1; (b) device 2.

4 试验过程、结果及数据对比分析

4.1 激光试验过程及结果

试验中,器件1的漏源电压为520V,栅源电 压为0V;器件2的两极反向偏压为90V.两款测 试器件均处于关闭状态.使用飞秒激光对器件进行 扫描,当激光扫描至器件辐射敏感位置时会观察到 电流瞬态变化,入射能量越强,可用于发生TPA 的光子数越多,有源区将产生更多的电子,继而导 致器件电流增大,当超出器件可承受的最大电流 时,器件发生单粒子烧毁.图8为发生SEB后的器 件实物表征;记录激光诱发SEB的能量值与器件 工作状态,结果如表3所列.

表 3 激光试验结果 Table 3. Laser test results.

器件	器件工作 电压/V	波长/nm	诱发SEB的 激光能量/nJ
器件1	520	620	3.3
	920	720	6
器件2	90	620	3.8
		720	4.5

4.2 激光等效重离子 LET 计算

4.2.1 激光有效能量计算

计算激光 ELET 首先需要通过脉冲激光有效 能量传输模型获取有源区的 *E*_{eff}.带入 2.2 关键参 数计算,器件 1 的有效能量与入射激光能量的比值 为 88.1%;器件 2 的金属布线层为材料金,代入 620, 720 nm 波长下的β值进行计算,得到两个波长下 的有效能量与入射激光能量的比值分别 93.7% 和 143%.表4为两个试验器件发生 SEB 的有源区有 效能量 *E*_{eff} 计算值.

表 4	器件有效能量 E_{eff}	
4 D	·	

	Table 4.	Device enective energy	Leff .
器件	入射激光 波长/nm	入射激光 能量/nJ	有效能 量 <i>E</i> _{eff} /nJ
器件1	620	3.3	2.91
	720	6	5.29
器件2	620	3.8	3.56
	720	4.5	6.44

4.2.2 重离子 LET 试验结果

TD-1-1-4

器件 1 的重离子 SEB 辐照数据由日本千叶重 离子加速器提供^[26],使用的离子为⁸⁶Kr³¹⁺离子;器 件 2 的重离子 SEB 辐照数据在中国原子能科学院 回旋加速器上进行,使用的离子为⁷⁴Ge²⁰⁺离子.

重离子造成的 SEB 结果与最低工作电压如表 5 所列.

	表 5	器件重离子 SI	EB 结果
Table 5.	SEB	results (Heavy i	ion) of the device
RF /4		毁坏时最低	LET (GaN)

器件	毁坏时最低 工作电压/V	${ m LET~(GaN)/} { m (MeV\cdot cm^2\cdot mg^{-1})}$
器件1	520	18
器件2	90	28.5

4.2.3 激光 ELET 与重离子 LET 对比

在该激光试验装置中,将 620 和 720 nm 波长 条件下双光子吸收系数 β代入 (3e)式计算可得 ELET 的表达式如下:

$$ELET_{620 nm} = 2.24 \times E_{eff}^2,$$
 (4a)

$$ELET_{720 nm} = 0.66 \times E_{eff}^2.$$
 (4b)

使用 (4a) 式和 (4b) 式可以得到两个波长的激 光 ELET 值并与重离子 LET 值对比, 结果如表 6 所列.

图 9为 620 与 720 nm 波长诱发 SEB 时, 激 光 E_{eff}^2 与重离子 LET 的对比关系.



图 8 器件发生 SEB 后的实物图 (a) 器件 1; (b) 器件 2 Fig. 8. The physical pictures of the devices after SEB: (a) Device 1; (b) device 2.

	Т	able 6. Comparison	of laser ELET and	Heavy ion LET.	
器件	毁坏时工作 电压/V	入射激光 波长/nm	有效能量 E _{eff} /nJ	激光ELET/ $(MeV \cdot cm^2 \cdot mg^{-1})$	重离子LET (GaN)/ MeV·cm ² /·mg ⁻¹)
器件1 520	520	620	2.91	18.97	18
	520	720	5.29	18.47	
器件2 90	620	620	3.56	28.39	00 5
	90	720	6.44	27.37	28.5





图 9 不同波长下器件发生 SEB 的 *E*²_{eff} 与 LET 关系对比 图 (a) 620 nm; (b) 720 nm

Fig. 9. Corresponding diagram of the relationship between $E_{\rm eff}^2$ and LET under different wavelengths causing SEB: (a) 620 nm; (b) 720 nm.

从图 9 对比看出,器件 1 与器件 2 的激光 ELET 与重离子 LET 等效关系,理论与试验符合.对于正 面入射激光有效能量传输模型,不同的波长入射得 到的 ELET 差距不大.而对于背部入射激光有效 能量传输模型,器件 2 在验证过程中入射激光波长 为 620 nm 时,较大的双光子吸收系数使得激光在 GaN 层的透光系数较小,从而有源区受到的金属 二次反射影响较弱,二次反射能量与有源区能量占 比约为 2.8%;入射激光波长为 720 nm 时,较小的 双光子吸收系数使得激光在 GaN 层的透光系数较 大,从而有源区受到的金属二次反射影响较强,二 次反射能量与有源区能量占比约为 36.5%.因此对 于材料参数未知的器件,背部入射模型的入射波长 选择 620 nm 优于 720 nm.

5 结 论

本文主要进行空间用 GaN 功率器件单粒子烧 毁效应激光定量模拟关键技术研究, 对基于 AlGaN/ GaN 异质结的 GaN 功率器件, 建立了适用于 HEMT 和 SBD 等结构的正面入射与背部入射脉冲激光有效能量传输模型,确立了模型中激光的入射波长、器件材料反射率与透光系数、界面间激光多次反射能量等普适参数,并计算了脉冲激光能量等效重离子线性传输能量 (ELET),从理论上分析 GaN 功率器件的脉冲激光定量模拟的可行性.

在试验测试的过程中,使用两款器件进行激光 辐射测试并与重离子实验数据做比较,其中正面入 射的能量传输模型有源区能量占比为 88.1%,620 和 720 nm 波长下背部入射的能量传输模型有源 区能量占比分别为 93.7% 和 143%;两款器件的激 光 ELET 理论计算和重离子试验结果符合性较好. 同时,由于背部入射的激光有效能量传输模型中, TPA 较小的入射波长受到的金属二次反射影响较 大,因此尽量选择较小的 TPA 波长对器件进行测 试;而正面入射的激光有效能量传输模型则不需要 考虑不同入射波长导致的结果差异.试验结果验证 了激光有效能量传输模型与 ELET 的推导对定量 模拟 GaN 功率器件 SEB 的可行性与准确性.

参考文献

- Saito W, Takada Y, Kuraguchi M, Tsuda K, Omura I, Ogura T, Ohashi H 2003 *IEEE Trans. Electron Devices.* 50 2528
- [2] Meneghesso G, Verzellesi G, Danesin F, Rampazzo F, Zanon F, Tazzoli A, Meneghini A, Zanoni E 2008 IEEE Trans. Device Mater. Reliab. 8 332
- [3] Millán J, Godignon P, Perpiñà X, Tomás A P, Rebollo J 2014 IEEE Trans. Power Electron. 29 2155
- [4] Zerarka M, Crepel O 2018 Microelectron. Reliab. 88 984
- Shikhar S, Ashish S, Subhashish B 2015 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition Charlotte, NC, USA, March 15–19, 2015 p1048
- [6] Chen R, Liang Y N, Han J W, Wang X, Yang H, Chen Q, Yuan R J, Ma Y Q, Shangguan S P 2021 Acta Phys. Sin. 11 116102 (in Chinese) [陈睿, 梁亚楠, 韩建伟, 王璇, 杨涵, 陈钱, 袁润杰, 马英起, 上官士鹏 2021 物理学报 11 116102]
- [7] Zhang F, Wang Y, Wu X, Cao F 2020 IEEE Access 8 12445
- [8] Scheick L 2014 IEEE Trans. Nucl. Sci. 61 2881
- [9] Cai S J, Tang Y S, Wei Y Y, Wong L, Chen Y L, Wang K L, Chen M, Schrimpf R D, Keay J C, Galloway K F 2000 *IEEE Trans. Electron Devices.* 47 304

- [10] Luo B, Johnson J W, Ren F 2001 Appl. Phys. Let. 79 2196
- [11] Kim H Y, Kim J, Liu L, Lo C F, Ren F, Pearton S J 2012 J. Vac. Sci. Technol. 30 012202
- [12] Zerarka M, Austin P, Toulon G, Morancho F, Arbess H, Tasselli J 2012 IEEE Trans. Electron Devices. 59 3482
- [13] Martinez M J, King M P, Baca A G, Allerman A A, Armstrong A A, Klein B A, Douglas E A, Kaplar R J, Swanson S E 2019 *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 66 344
- [14] Luo X, Wang Y, Hao Y, Li X J, Liu C M, Fei X X, Yu C H, Cao F 2019 IEEE Trans. Electron Devices. 66 1118
- [15] Buchner S, Howard J, Poivey C, McMorrow D, Pease R 2004 *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 51 3716
- [16] Han J W, Shangguan S P, Ma Y Q, Zhu X, Chen R, Li S 2017 J. Deep Space Explor. 4 577 (in Chinese) [韩建伟, 上官 土鹏, 马英起, 朱翔, 陈睿, 李赛 2017 深空探测学报 4 577]
- [17] Buchner S, Miller F, Pouget V, McMorrow D 2013 IEEE Trans. Nucl. Sci. 60 1852
- [18] Ngom C, Pouget V, Zerarka M, Coccetti F, Crepel O, Touboul A, Matmat M 2021 Microelectron. Reliab. 126 114339
- [19] Khachatrian A, Roche N J, Buchner S, Koehler A D,

Greenlee J D, Anderson T J, Warner J H, McMorrow D 2016 IEEE Trans. Nucl. Sci. 63 1995

- [20] Roche N J, Khachatrian A, King M, Buchner S, Halles J, Kaplar R, Armstrong A, Kizilyalli I C, Cunningham P D, Melinger J S, Warner J H, McMorrow D 2016 16 th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems(RADECS) Bremen, Germany, September 19–23, 2016
- [21] Khachatrian A, Roche N J, Buchner S, Koehler A D, Anderson T J, Cavrois V F, Muschitiello M, McMorrow D, Weaver B, Hobart K D 2015 *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 62 2743
- [22] Shangguan S P 2020 Ph. D. Dissertation (Beijing: University of Chinese Academy of Sciences) (in Chinese) [上官士鹏 2020 博士学位论文 (北京: 中国科学院大学)]
- [23] Refractive index database, Polyanskiy M N https://refrac tiveindex.info/ [2021-12-5]
- [24] Mizuta E, Kuboyama S, Nakada Y, Takeyama A, Ohshima T, Iwata Y, Suzuki K 2018 *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 65 1956
- [25] Sun C K, Liang J C, Wang J C, Kao F J 2000 Appl. Phys. Let. 76 439
- [26] Chen H, Huang X, Fu H, Lu Z, Zhang X, Montes J A, Zhao Y 2017 Appl. Phys. Lett. 110 181110

Research on Single Event Burnout of GaN power devices with femtosecond pulsed laser^{*}

Cui Yi-Xin¹⁾²⁾ Ma Ying-Qi^{1)2)†} Shangguan Shi-Peng¹⁾ Kang Xuan-Wu³⁾ Liu Peng-Cheng¹⁾²⁾ Han Jian-Wei¹⁾²⁾

1) (State Key Laboratory of Space Weather, National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

2) (School of Astronomy and Space Science, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

3) (Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China)

(Received 13 December 2021; revised manuscript received 8 March 2022)

Abstract

The femtosecond pulsed laser is used to study the quantitative evaluation technology of the single event burnout (SEB) effect in GaN power devices. In this work, we establish two pulsed-laser effective energy transmission models for different device structures, analyzing and verifying the equivalent relationship between the effective laser energy and the heavy ion linear energy transmission (LET). The critical parameters of models are confirmed, including laser parameters and device parameters. The interface reflectivity between the layers is mainly considered. Meanwhile, the parameters are corrected by the multiple reflections between the interfaces, and the laser energy of the second reflection of the metal layer is considered. These measures can be used to reduce the error of the effective energy in the device active area. In addition, we validate the models experimentally. A gallium nitride high electron mobility transistor (GaN HEMT) and a schottky barrier diode (SBD) power device are used in the experiment on the irradiation by a femtosecond pulse laser. The effective laser energy thresholds and the laser equivalent LET threshold with two incident wavelengths of the SEB are calculated. The theoretical calculation value and the actual measured value are compared. The selection basis of the laser wavelengths is given by the detailed study. The support for the laser quantitative evaluation and the protection design of the SEB in GaN power devices is provided by this work.

Keywords: GaN power devices, femtosecond pulsed laser, Single Event Burnout, equivalent LETPACS: 61.80.Az, 61.80.Ba, 78.55.Cr, 61.80.JhDOI: 10.7498/aps.71.20212297

^{*} Project supported by Youth Innovation Promotion Association of Chinese Academy of Sciences, China(Grant No. 2018179), the Key Research and Development Program of Guangdong Province, China(Grant No. 2020B010170001), and the Beijing Municipal Science and Technology Commission, China(Grant No. Z201100003520002).

[†] Corresponding author. E-mail: myq@nssc.ac.cn